APR 1 8 2001

# MANUFA®TURE OF COLOR LIQUID-CRYSTAL DISPLAY CELL

Patent Number:

JP59078318

Publication date:

1984-05-07

Inventor(s):

TAKAMATSU TOSHIAKI; others: 02

Applicant(s)::

SHARP KK

Requested Patent:

\_\_\_ JP59078318

Application Number: JP19820190338 19821028

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/133; G02F1/137; G09F9/00

EC Classification:

Equivalents:

## Abstract

PURPOSE:To mass-produce a liquid-crystal display cell which has horizontally and vertically oriented areas together by depositing a vertically oriented layer on the surface of a substrate where an electrode pattern is formed and then superposing a horizontally oriented layer, and etching the horizontally oriented layer except on the electrode pattern.

CONSTITUTION: A transparent electrode film 2 is patterned on the glass substrate 1 and then an SiO base film after being vapor-deposited and baked is dipped in a 0.015wt% solution of F-150 (produced by DAINIPPON INK KK) for vertical orientation and dried to form the vertically oriented layer 3. Then, photosensitive polyimide is applied thereupon. In this case, "Photoneece " UR-3100 (TORAY KK) is used as said material and only; a part right over the transparent electrode 2 is exposed through a glass photomask, cured, and developed; and an unnecessary part is made into an elute and lapping is performed to obtain the horizontally oriented layer 4. Those two substrates are stuck together and liquid crystal obtained by mixing dichroic dye and Np liquid crystal together is sealed to constitute a color liquid-display cell. Thus, mass-production is achieved.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

# (B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭59-78318

1/133	識別記号	庁内整理番号 7348—2H	❸公開 昭和59年(1984)5月7日
 1/137 9/00	1 0 3 1 0 1	7370—2H 7448—2H H 6731—5C	. 発明の数 1 審査請求 未請求
			/ A

〔全 3 頁〕

# **匈**カラー液晶表示セルの製造方法

②特 願 昭

願 昭57-190338

②出 願 |

願 昭57(1982)10月28日

@発明者。高松敏明

**向松敏**明

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シヤープ株式会社内

⑫発 明 者 船田文明

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ株式会社内

⑩発 明 者 松浦昌孝

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シヤープ株式会社内

⑪出 願 人 シャープ株式会社

大阪市阿倍野区長池町22番22号

個代 理 人 弁理士 福士愛彦

外り夕

明 組 書

#### 1. 発明の名称

カラー液晶表示セルの製造方法

# 2. 特許請求の範囲

1. 電極パターンが形成された基板表面を界面活性剤により垂直配向処理した後、感光性硬化剤表面を水平配向のためのラビング処理した後、前記電極パターン部以外の感光性硬化剤を除去して垂直配向面を鑑量させることによりゲストホスト効果型液晶表示セルのセル基板を作製することを特徴とするカラー液晶表示セルの製造方法。

# 3. 発明の詳細な説明

#### く技術分野>

本発明はネマティック液晶中に二色性染料を添加したゲストホスト効果型液晶表示装置の製造方法に関し、特に、液晶表示セルを構成する 基板内面に水平配向処理部と垂直配向処理部をともに形成して表示部分が着色されるポジタイプのカラー表示を行なうカラー液晶表示セルの製造方法に関

するものである。

## く従来技術>

ゲストホスト効果を利用したカラー液晶表示に は正の誘電異方性をもつネマティック液晶(以下 Np液晶と称す)中に二色性染料を添加し、無電 界時(および初期)の液晶分子配向を茶板表所に 対して水平になるように処理したものと、また負 の誘電異方性をもつネマティック液晶(以下Nn 液晶と称す)中に二色性染料を添加し、無電界時 (および初期)の配向を禁板表面に対して垂夜に なるように処理したものがある。前者では無電界 時に着色し、電界印加時に無色となって電極部が 色めけしたネガ型表示となり、後者では無電界時 に無色、電界印加時に着色し、電機部が蕱色した ポジ型表示となる。両者を比較すると後者の方が ポジ型表示であることから表示効果が優れている 反面駆動電圧が高い、粘度が高い、応答速度が避 いといった問題点がある。また、ポジ包表示の場 合、電界オン,オフ時の二色性比が思いことから 良好なコントラストを得ることが困難である。

N p 液晶を用い、電極部を水平配向処理、電極 部以外を垂直配向処理することにより、上述の駆 動電圧及び応答速度等の問題を改善することは可 能である。これまで、このような観点から同一基 板上で電極部に水平配向処理、電極部以外に垂直 配向処理を施すという方式が既に提案されている (特開昭 54-24657号、特開昭 56-4121号)。 間一基板上に水平配向処理、あるいは垂直配向処 理の領域を設けるために特開昭 5.4−2.4657号で は電極上にSi0等の水平配向層を形成し、表示 する電極以外に酸処理、あるいは蒸煮によって垂 **商配向階を形成すると述べられている。しかしな** がら水平配向層を形成する具体的な方状について は説明されていない。一枚の基板上に精度よく水 平配向領域と、垂直配向領域を設けることは従来 の技術では非常に困難である。

一方、特朗昭 5 6 - 4 1 2 1 号では、まず基板全面 に酸化硅素の斜方蒸着を行ない水平配向層を形成 した後、ホトエッチング法により電極部以外の水 平配向層を除去し、レシチン等により垂直配向層

封入することによりカラー液晶表示セルを構成する。 個光板 7 を介して入射光 8 を照射すると液晶 セルを透過した変調光 9 は透明電極 2 の部分が着色され、カラー表示が実行される。 この液晶 のに でいた でいた でいから でいから でいから この という でいから この という でいから この 吸収 はほとんどなく 透過光は変調されず 無色となる。

次に、「記憶造の液晶パネルを製作する方法の「実施例を第3図に従って説明する。第3図(Mに示す如くガラス基板「上にITO膜(透明導電膜)2をパターン化したのち、垂直配向剤の下地膜としてSiOを蒸着する。SiOの膜厚は100~500Åとする。「地膜蒸着後、基板を100℃で30分間焼成する。焼成後、基板をF--150(大日本インや製)の0.015wtが水溶液中に浸破し、垂直配向処理を行なう。浸漬したのち燥処理により垂直配向処理解3を形成する。これを第3図(B)に示す。乾燥処理後、垂直配向層3の上に全面にわたって必

を形成すると述べられている。このが法では、斜方蒸着により水平配向層を形成するということから、処理する枚数が限られ、散産には不向きである。

#### く発明の目的〉

# く実 施 例 >

第1 図は本発明が適用されるゲストホスト効果型カラー液晶表示装置のパネル構造の1 実施側を示す。電極部で水平配向、電極部以外で糖値配向に設定されていることから電極部で射色したボリンを製炭がなされる。ガラス基板1の内値に透明で極2を形成した後、垂直配向所3を堆積し、更に透明電極2上の垂直配向層3には水平配向所4を重要することによりセル基板が構成されている。このセル基板を2枚対向配置し、その間隙に二色性染料5とNp液晶分子6の混合された液晶層を

光性ポリイミドを放布し、第3 図(C)に示す如く、 垂直配向処理層 3 上に水平配向処理層 4 となる絶 縁層を堆積する。感光性ポリイミド系高分子隙と しては例えばフォトニースUR-3100(東レ社製 商品名)を使用し、スピンナ(回転数1500RPM) で強布する。スピンナ強布後、100℃で1時間気 燥する。次に第8図のに示す如く紫外光によりガ ラスフォトマスクIIを介して感光性ポリイミド 膜を露光する。フォトニースは光硬化型の高分子 膜であり、ガラスフォトマスクリーによりITO 膜即ち透明配極2の直上のフォトニースのみを解 光し他の部分を遮蔽することにより、紫外線の照 射された部分のみが光硬化して現像液に不裕とな る。 鮮光した後、第3以何に示す如くフォトニー ス表面を琢磨布付ローラー2によりラビングする。 ラピング後、現像液DV 140(収レ製、UR-3100 指定現像被)で現像して不要なフォトニースを除 去し、更にイソプロパクールに浸放してリンスを 行なった後、乾燥させる。以上によりフォトニー スがフォトエッチングされ、パタ--ン精度の高い

# 特別昭59- 78318 (3)

水平配向処理層 4 が得られる。その後、 130で、 3 0 分間及び 200で、3 0 分間の二段階 加熱を行 なって第 3 図例に示す垂直配向処理層 3 と水平配 向処理層 4 を有するセル基板を作製する。

以上の工程に従って製作した二枚のセル基板を貼り合わせ、その内部に液晶を注入する。セル芸板の貼り合わせに使用したシール樹脂はエポキシ樹脂R-2401(ソマール工業製)で硬化条件は80℃、1時間と120℃、1時間の二段階である。ホスト用液晶材料としてはピフェニル系液晶E-8(BDH製)を使用し、ゲスト用二色性染料としてはアントラキノン系染料G280(日本感光色素研究所製)を使用する。尚液晶材料及び二色性染料共に上配2棚に限定されるものではなく、他の液晶材料、二色性染料を用いてもよい。

#### く発明の効果>

本発明を適用することにより、液晶分子が電極 部で水平配向、電極部以外で垂直配向となり、駆 動電圧、応答速度の問題が改響されると共に、ホ トエスチング法により水平配向層を形成すること から下の電便との位置精度も高く、水平的向前域 と垂直配向領域の境界で配向が乱れるということ もない。また水平配向処理をラビングによって行 なえることから量産性も優れている。

## 4. 図面の簡単な説明

第 | 図は本発明が適用されるカラー液晶表示装置のパネル構造の | 実施例を示す構成図である。 第 2 図は第 | 図に示すカラー液晶表示装置の電界 印加時の説明図である。第 3 図は本発明の | 実施 例の説明に供するセル基板の製造工程図である。

代理人 弁理上 福 土 爱 彦(他2名)

